

国内	
1	特許第3276816号 電子線バイプリズム
2	特開平09-177975 真空容器
3	特許第2929005号 Si 微結晶構造の製造方法
4	特開2001-229868 ホログラフィ電子顕微鏡
5	特開2008-270056 走査型透過電子顕微鏡
6	特許第5201507号 生体適合性材料の表面浄化方法とそれに用いる洗浄装置 (登録2013)
7	特許第5351074号 試料ホルダおよび走査型透過電子顕微鏡 (登録2013)
8	特許第5970648号 透過型電子顕微鏡及び電子線干渉法 (登録2016)
米国	
1	US5811806 "Electron-beam biprism", 公開1998
2	US6344082 "Fabrication method of Si nanocrystals", 公開2002
3	US6573501 "Holography transmission electron microscope", 公開2003
欧州	
1.	EP00969126A Kazuo Furuya, Masaki Takeguchi, Kazuhiro Yoshihara, "Fabrication method of Si nanocrystals", 公開2000